ASN-320 1992

プリバンチャーの動作解析

加藤隆夫

まとめ

- プリバンチャーの電磁場分布の解析をした。その結果、グリッドリングは電場の一様性を保つ為に重要である事がわかった。
- 2)空間電荷を考慮したビームシミュレーションにより、プリバンチャ ーシステムの振る舞いを明らかにした。
- 3) 電流が 20 mA 以下では、空間電荷効果による動作特性の劣化は殆 ど無いと言える。

<u>序</u>

今から6年前、1985年に、筆者はプリバンチャーの高周波特性の測定を 行ない、報告した(参考文献1)。その中で、残念ながら出来なかった事を宿 題として残しておいた。

"更に詳しい解析をするには、二つの(電場)成分を分離して測るか、叉は、計算機で空洞のsimulationをする等が必要となる。"

この程、二つのコンピュータコードの利用により、新たにプリバンチャーの 解析ができたので報告する。利用したコードは、3次元電磁場解析コード MAFIA と、ビームトラッキングコード LEBT である。

1) プリバンチャーの概要

プリバンチャーの概略図を Fig. 1 とFig. 2 に示す。空洞は、半波長の 長さの同軸共振器である。共振周波数を201 MHz とすれば、半波長は746 mm となる。この長さで空洞を作ると、電場は最大で磁場が最小となる中心部にお いて、二つの加速ギャップを作って容量を持たせているので、共振周波数は低 くなってしまう。そこで、同軸方向の長さ(左右の短絡板により決める)を短 くして(583 mm) 共振周波数を201 MHz に合わせている。なお、長さ 583 mm の同軸共振器の共振周波数は 257.1 MHz (MAFIA では 258.2 MHz が得ら れた)である。

二つのギャップの間隔は 89 mm である。これは、750 keV の陽子が高 周波の 1 周期に走る距離(β = 0.04, βλ = 59.7 mm)の 1.5 倍になっている。 従って、二つのギャップの電場が逆位相になっている事(Fig.3参照)を考慮 すれば、陽子は二つのギャップで同位相で加速される事になる。加速ギャップ の周辺だけ取り出すと、中心に1個のドリフトチューブがあり、前後にハーフ ドリフトチューブがついている構造と考えられる。

ビーム孔の直径は 36 mm と大きく設定されている。後続のドリフトチ ューブにビームを絞り込む為に、プリバンチャー周辺のビーム半径は大きくな っている (エミッタンスが3 π mm·mrad の時、x 方向 17 mm、y 方向 13 mm、 Fig. 13) ので、この大きさでも充分ではない。しかしながら、第2節で示すよ うに、直径が大きすぎる為に、ビーム孔の加速電場分布が悪く、なんらかの形 で補正しなければ (ここではグリッドリングにより補正する)、ビームの質を 落とす結果となる。

同軸部分に二つの高周波カップラーがあり、一つを入力カップラーと して使い、他方には、整合負荷をつないで高周波電力を吸収し、空洞の負荷Q 値(Q,)を下げて運転している。

2) MAFIA によるプリバンチャーの電磁場計算

MAFIA V.3.0 を使って、3次元の電磁場を計算した。使用したメッシュ数は、41X41X95=159695であり、計算時間は89分である。基本モードの電場分布をFig.3 に、磁場分布をFig.4 に示す。加速電場(Ez)のZ方向の分布をFig.5 に示す。中心軸から5 mm、12 mm離れた場所の分布も同時に示してあり、中心軸上の最大値で規格化している。この図より、中心軸から12 mm離れた所では、中心軸の値よりピーク値で62%大きい事がわかる。叉、電場がドリフトチューブの中へ大きく漏れ込んでいる様子がわかる。加速ギャップの中心における加速電場(Ez)のX-Y平面上の分布をFig.6 に示す。これらの図が示すような、Z方向の分布が大きく異なる場合には、電場分布を反映するパラメーターT (transit time factor)が大きく変わる。Table 1 に、平均電場 E_0 , T、 E_0 Tをまとめて示す。 E_0 と E_0 Tは、x=0の値で規格化している。

Table 1 x=0, 5, 12 mm における加速のパラメーター (MAFIA の出力から計 算した)

(グリッドリングがない場合)

位置	E ₀	Т	E₀T	T(x)/T(0)
x=0	1.0	0.49	1.0	1.0
x=5	1.00	0.52	1.06	1.06
x=12	1.03	0.70	1.46	1.42

Table 1 より、軸から 12 mm 離れた位置では、実効加速電場は 46 % 増加して

おり、これはビームダイナミックスに大きな影響を及ぼす事が予想される。

実は、ここまでの話は、6年前のレポートに記した測定結果とほぼ一 致しており、実際、軸上と軸外のtransit time factorの比が、

T(r) / T(0) = I₀(kr), I₀(x) = 1 + x²/4 + x⁴/64 + --- (変形ベッセル関数) 、k = $2\pi/\beta\lambda$

で与えられるので、予測される事である。Tの比は、上式では、5mm で 1.07、12mm で 1.43 となり、Table 1 に示したMAFIA の結果と良く一致してい る。

さて、Rutherford (及びBNL)の設計者は、さすがにこの点を改良する 工夫をしている。それが、グリッドリングである。Fig.7 に計算に使用したグ リッドリングの概略を示す。このリングがドリフトチューブの四箇所に入って いる (Fig.1)。計算では、メッシュ数の制限からグリッドの幅を広くしてい るが、実際には、幅 0.1 mm のグリッドが3枚等間隔ではいっている。このグ リッドが等電位面を作ると考えれば、ビーム孔のサイズを実効的に非常に小さ くする結果になる。

Fig. 8 に加速ギャップの中心(Z=89/2 mm)における加速電場(Ez) のx-方向の分布を示す。これは、Fig. 6 の一つの断面を表示している事にな る。グリッドリングの効果は顕著である。Fig.9 とFig. 10 に加速電場の分布を 示す。グリッドリングがある場合の加速パラメーターをTable 2 に示す。

Table 2 x=0, 5, 12 mm における加速のパラメーター (MAFIA の出力から計 算した)

(グリッドリングがある場合)

位置	E ₀	Т	E ₀ T
x=0	1.0	0.91	1.0
x=5	1.02	0.93	1.04
x=12	1.02	0.94	1.05

加速電場の一様性の観点から見て、グリッドリングは非常に優れている事が わかる。一つ欠点をあげれば、僅かのビームロス(約10%)を生じる事であ る(参考文献2)。従って、出力ビームの仕様からグリッドリングを使うかど うか決める必要がある。

Fig. 11-1 に軸から 12 mm 離れた場所の 電場成分 Ez とEy を示す(グ リッドリングが無い場合、x=12, y=0)。Ey は、ギャップを中心にして符号が 変わっている。粒子の透過時間とプリバンチャーの運転法の最適位相の選び方 を考慮すれば、安定粒子(z方向へ加速も減速もされない粒子)はy方向へ加 速される。安定粒子に対して 90[°] 位相がずれている粒子は、y 方向の加速を 受けない。従って、プリバンチャーによりバンチングされる粒子の一部分は横 方向に力を受け、エミッタンスの増加の原因となる。グリッドリングはこの点 も改良すると考えられる(Fig. 11-2)。

最後に参考文献(1)との比較をしておこう。計算によれば、軸から 12 mm 離れた所では、ピーク加速電場は軸上に比べて62 % 大きい(Fig. 5)。測定では、58 % となっている。軸上のtransit time factor は計算で 0.49 、測定で 0.45 である。軸から 12 mm 離れた所の加速電圧(E_0 Tに比例する量)は、軸上 に比べて 測定値は24 % 大きくなっていた。、計算では、軸から 12 mm 離れた 所では、中心に比べて46 % 大きい電場となり、測定の約 2 倍である。測定と 計算の違いの理由は、よくわからないが、この付近は急激に z 方向の電場が変 わるところであり(Fig. 8)、測定のビード位置の設定が不正確であった点が 指摘できる。精密な測定が、更に必要である。

3) プリバンチャーのビームシミュレーション

計算コード LEBT を用いてプリバンチャーのビームシミュレーション を行なった。このコードは、RFQ とDTL の間のビームの運動を調べる為に新 たに書いたコードであり、その特長は、

1.3次元計算(x,y,z,t)を行なう、

- 2. 空間電荷効果を P P 法 (particle particle 間のクーロン力) で直接計 算する、
- 3. スーパーコンピューター (c 系) 用に書かれている、

の3点を強調できる。特に第3項は、実用上重要であり、ここでは、スカラ ーコンピューター(B-系)に比べて、30倍以上早い計算速度を得ている。 従って、c-系約20分の計算時間はB-系換算で600分となる。

プリバンチャーと DTL の間のビームラインを Fig. 12 に示す(参考文 献3)。図の中の数値は、以前に筆者が使っていた値と若干異なる点があるが、 本質的な差はないと思われる(下段の注参照)。Fig. 13 にベータファンクシ ョンを示す。入射ビームには 100 % エミッタンスが3 π mm·mradのK-V 分布を 用い、エネルギー幅はゼロ、位相幅は 360°とした。twiss parameters は、リニ アックのアクセプタンスにマッチするように決めた。なお、計算では、簡単の 為にプリバンチャーを一つのギャップ(ギャップ長さ 10 mm)に置き換えた。 そのギャップはプリバンチャーの中心に位置させた。ギャップの中の電場は一 様と仮定しているので、transit time factor は 0.95 となる。

DTL の捕獲効率を Fig. 14 に示す。捕獲効率は、DTL のアクセプタン スの位相幅に入射出来る粒子を勘定した。厳密にはエネルギー幅の条件も加え るべきであるが、Fig. 16 からわかるように、エネルギー幅の条件は、アクセ プタンスの端以外の粒子には殆ど効果がないので、大きな誤差は生まないと思 われる。叉、一般に DTL の横方向のアクセプタンスは入射ビームの 10 倍近く はあるので、こちらは考えなくてよい。従って、Fig. 14 で、捕獲効率が電流 の増大と共に下がる理由は、バンチが縦方向に広がるからと言える。

注)電圧の事

Fig. 14 の横軸の電圧と、参考文献(1)の Fig. 7 の電 圧とは、数値が違っている。この理由は、第一に、計算に使用し たビームラインの長さが 13 cm 近く違う事に由来する。この長さ の違いの原因は、以下の3点による。 . .

1)本計算では、プリバンチャーの中心をギャップとしているの に対して、文献(1)では、第1ギャップを使用していた事によ り 4.5 cm 異なる

2)計算の終わりを本計算では DTL の端板に設定しているが、文献(1)では第1ギャップ中心までとしていた事により約3 cm異なる。

3)そして、DTLの端板の内側と外側(端板の厚み)に起因する と思われる寸法測定の誤りが残りの 6.5 cm の原因であろう。

第二の理由は、本計算では ギャップ間電圧を意味しているのに対 して、文献(1)では、有効電圧を意味している事である。これ による差が約5%程度と思われる。

加速電圧が 25 kV の時の、ビームラインにおける横方向エミッタンス 増加の様子を Fig. 15 に示す。プリバンチャー入り口とDTL 入り口のエミッタ ンスを比較している。この増加の原因は、バンチングにより電荷密度が局所的 に増大したためである。その様子を Fig. 16 以下に示す。

電流がゼロの場合の縦方向の位相平面上の様子を Fig. 16 に示す。この図は DTLへの入射直前の様子を表している。電流が 200 mA の場合の様子を Fig. 17 に示す。バンチが形成されている中心部では、空間電荷効果の為に大きく歪められている事がわかる。これは、縦方向の場合を示しているが、同じ事は横方向にも起こり、エミッタンスの増加をもたらす。 Fig. 18 に示したのは、電流が 200 mA の場合の x - 方向のビームのエミッタンスである。

空間電荷効果が存在しても、電荷分布が一様で、空間電荷効果による 力が線形な力になる場合には、エミッタンスの増加が起きないように出来る。 プリバンチャーは、サイン波の電圧によりエネルギー分布に変調を与え、密度 変調を起こしているから、空間電荷による力は、線形な力から大きく、ずれる 結果となる。ビームの平均半径に相当する楕円体を仮定して、その中にビーム が一様に分布するとして、エミッタンスの増加を伴わない空間電荷力を計算す る。それと実際のバンチの中の各粒子に働く空間電荷力を比較した結果を Fig. 19 (縦方向)と Fig. 20 (横方向)に示す。図の中の濃い直線に各点が集まっ ていれば一様分布に近いと言える。これらの図から縦方向には、特に強い空間 電荷力が働く結果、Fig. 17 に示したようにエネルギー分布まで大きく変える 事がわかる。エネルギー分布をFig. 21 (20 mA)とFig. 22 (200 mA)に示す。 エネルギーの高い粒子はバンチの中心に後ろから近ずくから(進行方向に関して)、空間電荷力により減速されてエネルギーが下がる。従って、Fig. 21 の 両端の鋭いピークは内側にシフトして、分布の一様性は高まる事になる。従っ て、電流を増やしていくと、ある一定のエネルギー幅に入る粒子数が最大にな る事が予想される。実際、ある特定の場所で(ここではDTLの入り口)観 測すると、Fig. 23 に示すように 90 % エネルギー幅は大きく変化している。電 流が 300 mA の時のエネルギー分布はFig. 24 に示すように鋭くなっている。

大昔、200 mA 以上の陽子を入射させて、プリバンチャーによる横方 向エミッタンス増加を測定して、13% の増加(y-y',90%)を得ている(参考 文献4)。計算では 6%(x-x')、30%(y-y')となったが、その当時の陽子のy-y' は、現在の計算のx-x' に対応しているので、測定は計算の2倍となる。正確に 比較するためには、ビーム強度、プリバンチャーの運転パラメーター、横方向 のチューニング等の詳しいデータが必要である。ひとつ注意しておきたいのは、 バンチングが進むにつれてエミッタンスの増加が著しく進むことである。Fig. 25 にエミッタンス増加を場所の関数として示してある。DTLの直前の、普通 エミッタンスモニターが置かれる場所(0.75 m付近)は、エミッタンス増加 が急激に起こり始める場所に相当する。従って、リニアックのエミッタンス増 加をどの地点で定義しているかを明らかにしておかないと、混乱の素になる。

エミッタンス増加に非対称性がある事が、Fig. 15、25 からわかる。こ の点については、更に計算をしている所だが、入射ビームの横方向のマッチン グの具合と、ビームライン上のビームサイズに依存している事がわかっている。

参考文献

- 1) プリバンチャーの RF 測定、加藤隆夫、ASN 244, 1985.
- 2) KEK 20 MeV 陽子リニアックの新強度記録、穴見他、1979 年第4 回リニアック研究会、p.40, 1979.
- 3) 高木昭氏の資料を借用した。
- 4) Prebuncher によるEmittance の変化、坂上他、ASN 58, 1977.







Fig.3 Calculated electric field in a z-x plane.



Fig. 2 Geometry of the prebuncher (top view).



Fig.4 Calculated magnetic field in a y-z plane.



Fig. 5 Calculated electric fields in the z-direction at y=0 for the no-grid-rings prebuncher. z=0 stands for the gap center.



Fig. 6 Calculated electric fields Ez in the x-y plane in the gap center.



Fig. 7 Geometry of the grid-ring used for the calculation.



Fig. 8 Calculated electric fields in the x-y plane in the gap center. The circles indicate the fields with the grid-rings. The crosses indicate those without the grid-rings.



x=0 cm 1 -- x=0.5 cm **;** Ez (arbitrary unit) 0.8 x=1.2 cm 0.6 0.4 0.2 0 2 -2 -1 0 1 3 3 Δ z (cm)

!

ł

1.2

Fig. 9 Calculated electric fields on the z-axis. The black circles indicate the fields with the grid-rings. The white circles indicate those without the grid-ring.

Fig. 10 Calculated electric fields in the z- direction at y=0. The grid-rings are used.



Fig. 11-1 Calculated electric fields (Ez and Ey components) on an axis separated from the z-axis by 12 mm. The grid-rings are not used.



Fig. 11-2 Calculated electric fields (Ez and Ey components) on an axis separated from the z-axis by 12 mm. The grid-rings are used.



Fig. 12 Beam line between the prebuncher and the DTL.



Fig. 13 β -functions of the beam line.





Fig. 15 Calculated emittance growth caused by the space-charge effects in the beam line.



Fig. 16 Calculated longitudinal emittance for zero current at the DTL entrance. The buncher voltage is 25 kV.



Fig. 17 Calculated longitudinal emittance for a 200-mA beam at the DTL entrance. The buncher voltage is 25 kV.

Fig. 18 Calculated transverse emittance for a 200-m beam at the DTL entrance. The buncher voltage is 25 kV.





Fig. 19 Z-components of the electric field arising from space charge (200 mA) at the DTL entrance. The dots indicate the results of the exact calculation for each particle. The inclinedline indicates the calculated values with the uniformly distributed equivalent ellipsoid.

Fig. 20 X-components of the electric field arising from space charge (200 mA) at the DTL entrance. The dots indicate the results of the exact calculation for each particle. The inclinedline indicates the calculated values with the uniformly distributed equivalent ellipsoid.



Fig. 21 Calculated energy distribution for a 20-mA beam at the entrance of the DTL. The buncher voltage is 25 kV.



Fig. 22 Calculated energy distribution for a 200-mA beam at the entrance of the DTL. The buncher voltage is 25 kV.





Fig. 23 Variation of the energy-width (90%) versus current. The buncher voltage is 25 kV.

Fig. 24 Calculated nergy distribution for a 300-mA beam at the DTL entrance. The buncher voltage is 25 kV.



Fig. 23 Calculated emittance growth for a 200mA beam with a normalized 90% emittance of 4π mm·mrad versus drift length after the prebuncher.